

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-021432

(43)Date of publication of application : 30.01.1991

(51)Int.Cl.

B29C 67/00
 B29C 35/08
 // B23K 26/00
 G03F 7/20
 B29K105:24
 B29K105:32

(21)Application number : 02-103200

(71)Applicant : E I DU PONT DE NEMOURS & CO

(22)Date of filing : 20.04.1990

(72)Inventor : LAWTON JOHN A

(30)Priority

Priority number : 89 341517

Priority date : 21.04.1989

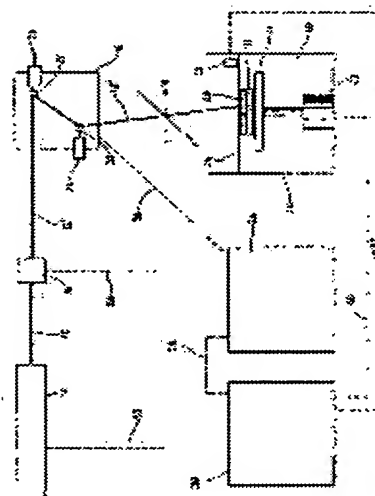
Priority country : US

(54) SOLID IMAGING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a three-dimensional matter by projecting radiation beam on the surface thin layer of a liquid photohardenable compsn. to subject the predetermined part of the compsn. to vector scanning in constant exposure quantity to optically harden the same and successively allowing this optically hardened thin layer to fall in a liquid to laminate the thin layer.

CONSTITUTION: The radiation beam 12 having required intensity generated by a radiation means 10 is passed through a modulator 14 and the modulated radiation beam 12' passes through a deflecting means 16. The radiation beam 12'' from the deflecting means 16 irradiates the thin layer 48 nearest to the surface of a photohardenable compsn. 40 to generate optical curing in a predetermined part. The positioning of a movable table 41 is performed by a setting means 42 and the setting means 42 is controlled according to the data stored by a computer control means 30. The figure data corresponding to the first layer having the shape of a rigid matter is sent to a computer control means 34 from the control means 30 to keep exposure quantity constant when the beam moves the predetermined part of the thin layer 48 in a vector mode. If the first layer of the rigid matter is completed, the movable table 41 is allowed to fall by a short distance and the same procedure is repeated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of
 rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-21432

⑮ Int.Cl.⁵
B 29 C 67/00
35/08
// B 23 K 26/00
G 03 F 7/20
B 29 K 105:24
105:32

識別記号

庁内整理番号

B

8115-4F
8415-4F
7920-4E
6906-2H
4F
4F

⑬ 公開 平成3年(1991)1月30日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全27頁)

⑭ 発明の名称 立体像形成システム

⑰ 特 願 平2-103200

⑱ 出 願 平2(1990)4月20日

優先権主張 ⑲1989年4月21日 ⑳米国(US)㉑341,517

⑳ 発 明 者 ジョン・アラン・ロー トン
アメリカ合衆国ペンシルベニア州(19350) ランデンバー
グ、オーバーンロード、アール・デー・ナンバー 2、
ボックス280

㉒ 出 願 人 イー・アイ・デュボ
ン・ド・ネモアース・
アンド・コンパニー
アメリカ合衆国デラウェア州ウイルミントン、マーケット
ストリート1007

㉓ 代 理 人 弁理士 高木 千嘉 外2名

明 細 書

1. 発明の名称 立体像形成システム

2. 特許請求の範囲

1) 液状光硬化性組成物の重なった層から一体
の三次元剛性物体を製作する方法であって、

容器内に液状光硬化性組成物を設置する段
階と、

放射線装置を用いて或る強さの放射ビーム
を発生させる段階と、

この放射ビームの強さをほぼ零から最大値
まで変調手段によって制御しながら変調する
段階と、

偏向手段を用いることによって、放射ビー
ムを重ねた薄い層上の所定位置までベクト
ル走査モードで制御しながら偏向させて液状
光硬化性組成物の所定部分の光硬化を或る光
硬化深度まで行くと共に、ゼロ・レベルから
最高値までの加速度で、そして、ゼロ・レベ

ルから最高値までの速度で放射ビームを偏向
させる段階と、

剛性物体の形状に対応する図形データを記
憶する段階と、

第2のコンピュータ制御手段を前記変調手
段、偏向手段および第1コンピュータ制御手
段と接続し、液状光硬化性組成物の所定部分
をほぼ一定の露光レベルで照射して各重なっ
た薄い層内ではほぼ一定の光硬化深度を達成す
る段階と、

容器内でほぼ平らな可動テーブル上に剛性
物体を置く段階と、

設定手段を用い、それを第1コンピュータ
制御手段で制御することによって平らなテー
ブルを制御状態で移動させる段階と、

第1コンピュータ制御手段によって制御さ
れる層形成手段によって液状光硬化性組成物
の重なった薄い層を形成する段階と

からなることを特徴とする方法。

- 2) 液状光硬化性組成物の重なった薄い層から一体の三次元剛性物体を精密に製作する装置であって、

液状光硬化性組成物を入れた容器と、

或る強さを有する放射ビームを与える放射線装置と、

放射ビームの強さをほぼゼロ・レベルから最高レベルまで変調する変調手段と、

放射ビームをベクトル走査モードで重なった薄い層上の所定位置まで制御しながら偏向させて液状光硬化性組成物の所定部分の光硬化を或る光硬化深度まで行い、また、ゼロ・レベルから最高値までの加速度で、また、ゼロ・レベルから最大の一定速度の速度でビームを制御しながら偏向させる偏向手段と、

剛性物体の形状に一致する図形データを記憶する第1コンピュータ制御手段と、

する。一層詳しく言えば、本発明は比較的高い出力のビーム放射源(たとえば、高出力レーザ)を制御しながら用いて比較的高い速度、精度で直接上記の製造を行うことに関する。

光硬化によって三次元モデルを製造する装置は種々提案されている。ヨーロッパ特許出願(1987年6月6日にScitex Corporation, Ltd.の出願した公開番号250,121)をここに参考資料として援用すると、これはこの技術分野に関する、Hull、Kodama、Herbertによるものとされる種々の方法を含む文献について良く要約している。付加的な背景としては、1988年5月21日にFudimに特許された米国特許第4,752,498号に記載されているものがある。これもここに参考資料として援用する。

これらの方法は固化させようとしている領域あるいは体積を順次に照射することによって段階的に三次元物体の立体領域を形成することに

変調手段、偏向手段および第1コンピュータ制御手段と接続してあり、液状光硬化性組成物の所定部分にはほぼ一定の露光レベルを与えて各重なった薄い層内でほぼ一定深さの硬化を行う第2コンピュータ制御手段と、

容器内で剛性物体を支持するほぼ平らな可動テーブルと、

第1コンピュータ制御手段によって制御され、可動テーブルに動きを与えて容器内の可動テーブルの位置を精密に制御する設定手段と、

可動テーブル上に設置してあり、第1コンピュータ制御手段によって制御されて液状光硬化性組成物の重なった薄い層を形成する層形成手段と

を包含することを特徴とする装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光硬化による三次元物体の造形に関

関する。種々のマスキング技術の他に、直接レーザ描画法、すなわち、光硬化性組成物を所望のパターンに従ってレーザ・ビームで照射し、三次元モデルを一層ずつ重ねて行く方法も記載されている。

しかしながら、これらの方法は、すべて、ベクトル走査の利点を、露光状態を一定に保ち、剛性の三次元物体の本体部を通じて各層毎のすべての硬化部分の最終厚さをほぼ一定にする手段と組合わせて利用する実用的な方法を認識していない。

さらに、上記従来方法は、方法、装置のパラメータを制御して実用的かつ有用に利用する特定の操作範囲内の重要な相互関係も認識していない。このような操作範囲としては、材料の光硬化応答性に依存した一定露光レベルの範囲、光硬化の解像度、深さに依存する最大加速度でのビームの最短移動距離の範囲ならびに光硬化

性組成物の感度に依存する最大ビーム強さの範囲がある。

たとえば、Scitex特許は均一な露光を達成するためにホトマスクあるいはラスク走査を使用することを示唆しているが、ベクトル走査の場合に露光を一定に保つための解答は示唆していない。ホトマスクを使用すると、時間、費用が過剰にかかるし、ラスク走査も以下に示す多数の理由のためにベクトル走査に比して望ましいものではない。すなわち、ラスク走査では、

製作しようとしている物体が全体積のほんの小さな部分である場合でも全域を走査する必要がある、

たいていの場合に記憶すべきデータ量がかなり大きくなる、

記憶したデータの取り扱いが全体として難しい、

CADベースのベクトル・データをラスク・デ

ラツキが生じる。特に、高強度での露光が直前に行われていない層部分の場合には、高いビーム速度を使用する必要がある、したがって、良い加速時間が必要となり、これがまた露光組成物の不均一な厚さの原因となる。低強度のレーザを使用する場合には、立体物体の造形に過剰な時間がかかるので、良い結果が得られない。さらに、本発明について以下の説明で明らかにするような光硬化性組成物の少なくとも前述の深さ、露光レベルの関係が維持されないかぎりベクトル走査の有用性はさらに低下する。

したがって、本発明の目的は精密に制御された深さ、解像度の三次元モデル層を順次に走査し、形成することによって露光されていない光硬化性組成物上にベクトル・モードで直接レーザ描画を行う方法および装置を提供することにある。

本発明はベクトル・モードで直接レーザ描画

ークに変換する必要がある。

一方、ベクトル走査の場合には、剛性物体の形状に対応する領域のみを走査すればよく、記憶すべきデータ量が少ない程、データの取り扱いがより容易になり、「CADベース機の90%を超える機種がベクトル・データを発生、利用している」(Lasers & Optonicsの1989年1月号、第8巻第1号の56頁)。レーザ・ベクトル走査がこれまで広く利用されてこなかった主たる理由は、その利点もさることながら、レーザのような現在のたいていの放射線源のために利用できる偏向システムの光学部材、たとえば、ミラーの慣性に関する問題を内包しているということである。このような偏向システムは性質上電気機械式であるから、いかなるビーム速度を達成する際にもそれに伴う加速度には限界がある。速度の不均一性は避けることができないので露光した光硬化性組成物は許容できない厚みのバ

を行う高強度レーザを用いて一層ずつ三次元光硬化モデルの直接的な製作を行う方法および装置であって、光硬化性組成物における露光軌跡の深さを精密に制御する方法と装置を目的とするものであり、それを要約すると次の通りである。すなわち、液状光硬化性組成物の重なった層から一体の三次元剛性物体を製作する方法は、

容器内に液状光硬化性組成物を設置する段階と、

放射線装置を用いて或る強さの放射ビームを発生させる段階と、

この放射ビームの強さをほぼ零から最大値まで変調手段によって制御しながら変調する段階と、

偏向手段を用いることによって、放射ビームを重ねた薄い層上の所定位置までベクトル走査モードで制御しながら偏向させて液状光硬化

性組成物の所定部分の光硬化を或る光硬化深度まで行くと共に、ゼロ・レベルから最高値までの加速度で、そして、ゼロ・レベルから最高値までの速度で放射ビームを偏向させる段階と、

剛性物体の形状に対応する図形データを記憶する段階と、

第2のコンピュータ制御手段を前記変調手段、偏向手段および第1コンピュータ制御手段と接続し、液状光硬化性組成物の所定部分をほぼ一定の露光レベルで照射して各重なった薄い層内ではほぼ一定の光硬化深度を達成する段階と、

容器内ではほぼ平らな可動テーブル上に剛性物体を置く段階と、

設定手段を用い、それを第1コンピュータ制御手段で制御することによって平らなテーブルを制御状態で移動させる段階と、

第1コンピュータ制御手段によって制御される層形成手段によって液状光硬化性組成物の重

なった薄い層を形成する段階とからなる。

本発明の好ましい実施例の実際の意図を読者に理解して貰うべく、以下、添付図面に関連した詳しい説明を行う。

本発明は光硬化によって三次元物体を造形する方法および装置に関するものであり、一層詳しくは、比較的高い速度と精度で直接前記造形を行うべく比較的高出力のレーザを制御しながら使用することに関する。

ここで第1図を参照して、ここに示す放射線装置10(たとえば、レーザ)は放射ビーム12を発生する。本発明の目的が高速で立体的な物体11を製作することにあるので、本発明の装置は高出力レーザのような比較的高出力の放射線装置10を利用すると好ましい。この高出力レーザは可視領域、赤外線領域あるいは紫外線領域にある主要帯域を持ち得る。ここで、高出力とは、

20mWより大きい出力と考えており、好ましくは、放射ビーム12の強さから測定して100mWを超える出力である。これは現在の光硬化性組成物の感度に合わせてある。しかしながら、もっと速い組成物を利用できるようになった場合には、ビーム強さについての20mW、100mWの値はそれに応じて低くなることになる。これは組成物の感度と放射ビームの強さが同じ結果を得るには互いに反比例の関係を持つからである。或る種のレーザの選択は、光硬化性組成物の感度がレーザ放射線の波長とうまく一致するように光硬化性組成物の選択と一緒に考えなければならない。他の種類の放射線装置も、そのエネルギー形式が光硬化性組成物の感度と一致し、ビームが発生し、取り扱いについて最適な状態が周知の確立した方法によって観察されるかぎり、利用できる。たとえば、電子ビーム、X線等も利用できる。ビーム横断面形状を任意所望の形状に

偏向する手段を設けてもよいが、普通の形状としては円形であり、ビームの強さの分布はガウス分布であり、最高点は円形の中心にある。

放射ビーム12は変調器14を通り、この変調器は音響光学変調器であると好ましい。変調された放射ビーム12'は、次に偏向手段16を通る。この偏向手段は2つのミラー20、22を包含し、各ミラーはX方向、Y方向において面46に対してビームを反射させ得る軸線(図示せず)を有する。ここで、X方向、Y方向とは互いに直角でありかつ面46に対して平行である。ミラー20、22はモータ24、26によってそれぞれ対応する軸線まわりに回転して、それぞれ、X、Y方向において容器44に入っている液状光硬化性組成物40の所定の位置に向ってベクトル走査モードでビームを制御しながら偏向させるようになっている。適当な光硬化性組成物の例は後に示す。ビームが偏向手段16によって偏向されると、こ

のビームはゼロ・レベルから最高値までの加速度と、ゼロ・レベルから最高の一定値までの速度を持つ。ビームの速度および強さは互いに比例したままであり、その結果、露光がほぼ一定に留まる。ビームはほぼ一定の光硬化深度まで組成物の所定部分の光硬化を生じさせる。光硬化深度は、走査方向に対して直角の横断面で測って、面46と光硬化した薄い層の対向側面の間の最大厚さすなわちピーク厚さとして定義される。後に説明するように、各個々の光硬化層あるいはその一部の厚さは或る走査線上のポイント毎に異なる可能性がある。したがって、混乱を避けるべく、ここで言う光硬化厚さとは前記層の任意のポイントでの厚さのことであり、硬化深度は上記の定義に限定する。容器44内には、可動テーブル41とエレベータ・モータ42のような設定手段が設けてあり、このエレベータ・モータは可動テーブル41に動きを与えて容器44内

示していない。

上述したように、一定の露光を得るように放射ビームを変調することはアナログ方式でもデジタル方式でも行うことができる。Greyhawk®の製造する市販のシステム(Greyhawk Systems, Inc., 1557 Center Point Drive, Milpitas, CA 95035)を後述のように改造して露光レベルを一定値に制御する本発明の第2コンピュータ制御手段34の一部として使用してもよい。Greyhawk®システムはモータ24、26の軸に取り付けたエンコーダ(図示せず)の発生したパルス信号を、像空間の存在および所望露光量を考慮してデジタル式に処理され、レーザを直接変調する電気パルス信号に変換する。これらのエンコーダは軸の回転を示し、したがって、像形成面46におけるミラーから反射してきたレーザ・ビームの対応する動きを示す。効果的には、レーザはビームが像平面で動いた個々

で可動テーブルの位置を精密に制御するようになっている。テーブル41の動きは並進運動、回転運動、無作為運動あるいはそれらの組み合わせのいずれであってもよい。ドクタ・ナイフ43のような層形成手段が容器44内でテーブル41の上方に設置してあり、これは液状光硬化性組成物の重なった薄い層を形成する。また、第1コンピュータ制御手段30と第2コンピュータ制御手段34も設けてある。第1コンピュータ制御手段30は、制御/フィードバック・ライン52、60、62、58のそれぞれを介して放射線装置10、設定手段42、層形成手段43および第2コンピュータ制御手段34と接続してある。第2コンピュータ制御手段34は、ライン58を介しての第1コンピュータ制御手段30との接続に加えて、制御/フィードバック・ライン50、54のそれぞれを介して変調器14と偏向手段16にも接続している。存在の明らかな補助的な装置類は簡略化のために

の距離に対応させてデジタル式に変調する。レーザの変調にはレーザが1パルスあたり或る特定の時間枠にわたってオン状態にあることが必要なので、像平面でレーザ・ビームが動いた距離あたりのかなり均一な露光が得られる。

非固体素子のレーザの直接的なデジタル変調は、このようなレーザが立体像形成にとって有用なほど高い率でデジタル式に変調され得ないために、現在のところ非実用的である。これらのレーザは連続的にしか作動できない(CW)。パルス状に作動する場合、パルス反復率あるいはパルス時間幅またはこれら両方がGreyhawk®システムの電子機器の発生する変調信号に追従できないからである。この場合、像平面に不均一な露光が生じる。非固体素子レーザのビームをGreyhawk®のようなシステムで要求される高い率で変調するには、固体素子レーザを作動するのに適した電気信号を徹底的に修正してCWレ

ーザのビーム経路にある光スイッチを作動させなければならない。光スイッチならびにそこで用いられる変調用電子機器は電気変調信号に追従できなければならないし、「オン状態」で適切な伝送効率を持っていて像形成面46で必要とされる有用なビーム・エネルギーを与えなければならない。このような光スイッチ類はアナログ式でもデジタル式でもよいが、最も好ましいタイプは音響光学式である。

本発明で使用され得る他のスイッチ類の例としては次のものがある。

まず、電気光学式スイッチであり、これは電圧を印加したときに光学的偏性を変える結晶を基礎とするものである。

次に、液晶ゲートであり、可視領域で用いられるものであり、ビーム・ゲートと呼ばれる、Meadowalk Optics (7460 East County Line Road, Longmont, Colorado 80501) の製造した

って回転させられ、第2偏光子を通過することができる。

この分野では周知のように、実質的な目的のため、より良く理解して貰うため、そして、より良い説明のため、第2図にP1、P2、P3、……Pnで示すように、二次元面に位置する像をピクセルと呼ぶ小さな仮想面積単位に分割するのが望ましい。これらのピクセルは通常は正方形であり、X、Y両方向に同じ寸法を有する。矩形その他の形状の代わりに正方形を選んだ主たる理由は、多くの場合、X、Y両方向において同じ解像度が得られ、また、それが望ましいからである。同様にして、或る立体像を考えた場合、立体像の体積を第3図にV1、V2、V3、……Vnで示すようにボクセルと呼ばれる小さな仮想立方体に分割すると良い。上述したと同じ理由で、この立方体は1つのボクセルの好ましい形状であり、したがって、このボクセルはX、Y、Z

のものがある。これも液晶物質の偏光状態の変化を基礎とする。

また、ダイアフラムを動かすことのできる圧電セルもあり、たとえば、小ピンホールである。

最後に、偏光状態に依存するいわゆるPLZT (Pb 0.9、La 0.1、Zr 0.65、Ti 0.35)ベースのスイッチである。ここでは、2枚の偏光板が互いに90度で交差する軸線をもって設置しており、それらの間にPLZTフエロエレクトリック結晶が挿入してある。PLZT結晶はそれに電界が与えられているかいないかに依存して通過する光の偏性を回転させることができる。現在、オフ位置にあるとすると(すなわち、PLZTが電界を持っていない場合には)、第1の偏光子を通る光はPLZTによって変化せず、第2の偏光子によって阻止される。しかしながら、PLZTが電界の下にある場合には、第1偏光子を通る光はPLZTによ

のすべての方向において同じ寸法を持つことになる。

本発明の装置、方法の製品を走査線間隔、すなわち、光硬化性組成物40の表面46上のビーム12の任意の2つの隣り合った走査線(互いにほぼ平行である)の中心間隔に等しい線寸法を有する立方体ボクセルによって説明すると好ましい。

二次元像形成技術について簡単な外挿法を使用することによって、立体すなわち三次元の像形成の動作特性、たとえば、走査線の最適間隔を予想できると、普通は考えられよう。しかしながら、それは当たっていない。事態はもっと複雑である。というのは、特に、立体像形成では光硬化深度および厚さのような新しい複雑な変数(二次元像では小さいし、一定値である)が存在し、積極的に関わりを持つからである。光硬化性組成物の表面上の或る線に沿って合焦レ

ーザ・ビームを一回走査した場合(単走査)、単純に考えると、矩形横断面を有する直線立体と受け取られよう。専門家であれば、このような横断面がガウス横断面分布を有する放射ビームから生じるようなガウス形状となると予想するかも知れない。しかしながら、いずれの予想も当たっていない。このように形成された直線立体の横断面が予想外にほぼ非ガウス形状であることを本出願人は発見したのである。換言すれば、この方法で形成された直線立体をその長さ方向に対して直角に切断した場合、液面で始まる幅が立体の先端付近まで表面46から遠くなるにつれてほぼ線形に減少するのである。この横断面特性は走査立体像形成にとっては重要な情報である。なぜならば、通常、層を走査して各横断面薄片領域を部分的に埋めて行くとき、走査は完全な立体面を生じさせるように互いにほぼ平行に隔たった線またはベクトルからなる、各ベ

クトルの幅が表面46から離れるにつれてほぼ線形に減少するという知識があれば、均一な露光ならびに均一な光硬化深度を得るためのベクトル線の適切な間隔を決定することができる。適切な線間隔の場合、各薄層の底における厚さの変化であるリプルが最小限に抑えられ、層のうねり傾向が低減され、部分解像度、公差が保たれ、各層の強度がより大きくなると共に方向による強度の差が小さくなり、層対層の接着性が改善され、走査線の数を最小限に抑えることができる。本出願人が目的とすることは、単走査立体線の横断面がほぼ非ガウス形状となることにある。その理由は、走査中の放射ビームがガウス形エネルギー分布の場合、その立上がり部分が光硬化性組成物の対応した部分を光硬化させる能力に関して無効となるからである。これには多数の原因があり、たとえば、次の原因がある。

光硬化が生じ得ない領域、この分野では誘導領域として周知の領域内で露光程度が低くなる。

円形ガウスビームの単走査中、移動しているスポットの中心の軌跡に向う部分(このスポットはビームと光硬化性組成物の表面との交差点にある)が、スポットの速度に逆比例して変化するガウス・モードでは、必然的に、この軌跡から遠い部分よりも高い露光を受けることになる。これはビームによって影響を受けるすべての層にもそれ相応に当てはまることになる。ガウス機能とS字形の光硬化厚さ対露光関係の組み合わせ(立体像形成では、深度・露光曲線と定義できる)の1例が実施例1において説明される本発明の好ましい組成物のうちの1つの組成物の作用に関して第4図に示しており、これは単走査線の非ガウス形状を説明している。

光硬化深度ならびに光硬化厚さが光硬化性組

成物の性質、ビーム強さおよび直接ビーム入射時刻の関数となるばかりでなく、他のパラメータおよび二次的効果(たとえば、走査重複、隣接した部分を照射したときに生じる二次露光等)にも依存するという事実に注目するのも非常に重要である。たとえば、1本の走査線の光硬化性深度は連続したフィルムを形成する複数本の密接に重なり合った走査線の光硬化深度よりもかなり小さい。同様に、他のすべてが一致に保たれていると仮定すれば、走査線の数が多ければ多いだけ、互いに接近度が大きくなり、それだけ光硬化深度が大きくなる。また、縁が片側だけで隣り合った露光走査線を有するので、全体の露光度が低くなり、正しい段階を踏まないかぎり、光硬化中に中間部分よりも光硬化深度が小さくなる。

上記の現象を原因として、普通の二次元像形成と立体像形成の間には第2の重要な差異(後

に詳しく説明する)が現れる。普通の二次元像形成システムで走査線を形成するには、走査線間の距離がガウス強度分布を持つ像形成用ビームの直径 $1/e^2$ にほぼ等しいかあるいはそれより小さいときに、像の目に見えるリプル感を排除すべく適切な走査線間隔が生じるということはこの分野では公知である。立体像形成の場合、この間隔での走査線の設置により、実施例1に記載する組成物の場合に各層の下面に際立ったリプルが生じることになる。その理由は、露光に対する材料の応答性の非ガウス形状が光硬化した両層の許容範囲の均一な厚さを与えるほど重なり合うことがないためである。

したがって、走査間隔の決定は、ボクセルの寸法の決定に直接通じ、立体像形成システムの解像度能力を製造しようとしている剛性物体の公差要件に合わせることになるので、非常に重要である。

ビームが連続的にオンであるときに一定速度単一走査線に対して直角に切断されたビーム・スポットの中心まわりの正規化されたガウス露光と、

一定速度の単一ベクトルで走査され、走査方向に対して直角に切断された光硬化物質(実施例1の組成物を含む)の正規化された実際の厚さと、

同じ条件の下に走査された予想される正規化光硬化厚さとを示している。

これらの曲線は共通最高相対値1に対して正規化されていて分布の差を良く示している。

ここで、単一走査露光の中心まわりの光硬化厚さの数学的な予測の分布は実際に材料について測定した厚さの分布にほぼ一致し、これは露光分布の形にそのまま基づいて予想されるものとはかなり異なっている。

単一の走査線の横断面のすべてのポイントにおける詳細な光硬化厚さとビーム線の対応したガウス形強度分布に対する露光との関係は次の等式に従うことがわかった。

光硬化厚さ =

$$G(E) = G(P \exp[-2((Y/r_0)^2)] / (\sqrt{2\pi} v r_0)) \quad (1)$$

ここで、 $G(E)$ は露光 E (mJ/cm^2)に答える材料の深さに良く合った関数を表わし(実施例1の組成物には二次自然対数多項式を用いた。 $G(E)(mm) = -0.66 + 0.446 \ln(E) - 0.356(\ln(E))^2$)、 P は像平面におけるビーム放射束(mW)であり、 Y は走査中心から離れる可変距離であり、 r_0 はガウスビームの $1/e^2$ ビーム半径であり、 v は表面を横切るビーム走査速度である。ここで驚くべきことには、 $G(E)$ を二次自然対数多項式と関係させる等式における露光単位が無次元でなくとも、良くなじむということである。

第5図は、

組成物の露光に対する応答性の決定は、立体像形成システムの解像度ならびに組成物応答性に基づく所望の公差で物体を製造するシステム全体の能力の決定に通じるので、立体像形成にとっては必須である。線、層ならびにそれに続く部分公差を保つ能力に通じる所与の時間・パワー解像度に対してレーザ・エネルギーを制御するのが光学システムの能力である。光学走査システムは、所望の寸法、位置に対してレーザ・エネルギーを方向付け、合焦するという点で優れた解像度を持ち得る。しかしながら、それは線、層および製造される部分の公差を規定する吸収されたエネルギーに対する材料の応答性となる。

単一走査線の分布についての知識によれば、相互の接合を生じさせかつ先端間の領域を埋めるに適した程度に重なり合っている平行な線によって形成される層が連続的にオンのビームで

走査される一連の単線の厚さ応答性を単に加えるだけでモデル設計され得ると考えるのが普通である。このような数学的なモデルは次の等式を持つことになる。

$$\text{光硬化厚さ} = \sum_{Y_k=0}^{Y_k} G(E) = \sum_{Y_k=0}^{Y_k} G(P \exp[-2((Y/r_0)^2)] / (\sqrt{2\pi} \cdot v \cdot r_0)) \quad (2)$$

ここで、Yは走査方向に直角で像平面（第1図の表面46）に対して平行な方向における第1走査ベクトルの中心からの距離を表わし、Y_kはY=0に対する各ベクトル走査中心の、隣り合った線についてその効果を総合した軌跡を表わす。

しかしながら、本出願人等の研究では、この数学的なモデルは光硬化厚さに関係するような組成物の露光応答性に応じて後に行われる連続走査露光回数の合計に基づくモデルよりもかなり劣ることを見出した。このような数学的モデルは次の等式を持つ。

応答性に一致することが確認されている。

式(3)の数学モデルが光硬化性組成物応答性を正確に予測させるものであるというさらなる証拠が第7図に示してあり、ここには、このモデルが実質的に光硬化厚さを示していることが明らかにされている。

先に指摘したように、普通の二次元像形成と立体像形成との第2の重要な差異は各層の下面において明らかになる。銀ハロゲンフィルムで用いられるような二次元走査の場合、走査間隔（すなわち、フィルムに像形成しているときの走査線間の距離）が像平面でのビーム焦点の $1/e^2$ 直径と同じ幅であることは普通のことである。或る種のスキヤナはより密接した走査線間隔を与えるが、まれには、ビームの $1/e^2$ 直径未満の場合もある。二次元像形成の場合、この比較的広い間隔はいくつかの理由のために適切である。これらの理由の1つは、

$$\text{光硬化厚さ} = G(\Sigma E) =$$

$$G\left(\sum_{Y_k=0}^{Y_k} P \exp[-2((Y-Y_k/r_0)^2)] / (\sqrt{2\pi} \cdot v \cdot r_0)\right) \quad (3)$$

ここで、位置Y_kに沿って位置した各ベクトル走査からの露光貢献度は各個々の位置Yについてまず合計され、次いで、露光応答性G()がこの露光合計に適用される。

式(3)の式(2)以上の精度の決定は第6図のグラフから容易に理解できる。この第6図では、3本の連続した走査線が或る特定の間隔で引かれた式(2)に基づく数学モデルが、光硬化性組成物の底におけるリブルが同じ間隔をもって3本の走査線を引いた場合に式(3)が示すものよりも2倍の周波数を持つことになることを誤って示している。実施例1に記載された組成物の表面に同じ間隔で互いに平行に延びる走査線によって形成した層の顕微鏡写真から得た測定結果で式(3)で示すリブル周波数が実際の組成物

裸眼はより密接な走査間隔が狙くなる像暗密度の変化に鈍感であるということである。一方、特に、高い解像度部分を得ようとする場合には、立体像形成では、二次元像形成での走査間隔よりも密接な走査間隔を必要とする。これは、露光に対する非ガウス材料厚さ応答性が光硬化性組成物内への均一な光硬化深度を与えるほど重なり合うことがないためである。立体像形成の場合、走査間隔は像平面での像形成ビームの全幅の最大半分すなわち $1/e^2 \cdot 0.693$ に等しいかあるいはそれより小さいことが好ましく、底面のリブルを最小とする。第8図の曲線は、式(3)の数学モデルに基づいた予測から導き出したものであり、実施例1の組成物の像形成層（この層の最大厚さは0.127μmとなるべきである）の底面における、連続ビーム走査間隔の変化によるリブルの変化を示している。ここで、 $1/e$ スポット直径に等しい走査間隔の場合、層の重要部

分が走査中心線の間でセグメント化されていることに注目されたい。

走査中心線間のこのようなセグメント化の効果はもっと論議する価値がある。特徴的なのは、層の剛さが厚さの3乗に比例して変化するということである。すなわち、厚さが2だけ減れば、その層の剛さは先の値の8分の1まで低下することになる。第8図において、 $1/e$ 直径の間隔で連続的に走査された材料は厚さが最高値の30%まで低下した領域を有する。このような層では、この薄い領域での相対剛さ、したがって、走査線に対して直角の方向における剛さは98.7%の因数で低下することになる。 $1/e \sim 0.693$ ビーム直径の走査間隔でも、走査線に対して直角な方向における層の方向の場合のほんの36%の値となると予想できる。 $1/e \sim 0.5$ の走査間隔では、剛さはこの方向における最大値の65%まで減る。この剛さの差は自立層の脆弱化を招き、

節されるべきである。

走査間隔の決定は、上述したようにボクセルについての寸法確立に直接通じ、したがって立体像形成システムの解像度、公差能力に関係するので重要である。この寸法確立によれば、1つのボクセルのX、Y、Z寸法は互いに等しく、走査線間隔に等しい。光硬化の深度および幅は材料の露光特性ならびにビーム特性に応じて変化する。光硬化深度は単走査線の場合の光硬化幅に匹敵する、換言すれば、それと同じ程度の大きさであると好ましい。したがって、重なり合った多重走査線の場合、光硬化用の露光は走査線間隔の間隔に応じて変わらなければならない。走査間隔が像平面での露光ビームの $1/e \sim 0.693$ スポット直径より小さいか、あるいは、それに等しい値であると好ましい。

前述したように、レーザ等のような放射ビームのベクトル走査を行う公知の偏向装置では、

材料内の応力の変化により層のうねりを生じさせ、形成された層がその下になんの支えもないとき（すなわち、片持つ支持されるか、架構支持されるかしたとき）最終部分における公差損失と考えられる。

しかしながら、より密接な走査間隔に移行するにはかね合いを考えなければならない。走査線の密度が高くなるので、層を形成する時間が長くなるのである。この余分な時間は、線に沿った走査が同じ光硬化深度を保つようにスピードアップされるはずなので、幸いにもそれほど重要とはならない。第9図の曲線は走査線に対して直角の方向における層形成速度の変化を走査間隔の関数として示している。ここで、層間隔が密接になるにつれて、層形成速度が実際に平らになることに注目されたい。実際に、この速度は各ベクトル走査線の端にベクトル・ミラーを設置することに伴う時間損失について調

任意のビーム速度に達する際に質量加速度を伴う。この避けようのない速度不均一は、特に、層がその下に直接の基層を持たない部分を有する場合には、許容できないほどの厚さの変化を招く。これは、適性露光レベルを高い強さに保つために、高いビーム速度を用いなければならない、したがって必然的に加速時間が長くなるからである。これが、また、加速期間中に露光エネルギーが適切に制御されない場合には厚さの不均一を招く。低出力レーザでは、厚さの不均一は加速期間中に幾分無視しえるが、立体物体の製作時間が長すぎることになって低強度レーザを使用しては良い解像度が得られない。

走査方向に対して直角なスライスではなくて走査方向に対して平行でかつ像形成平面に対して直角なスライスを採用して本出願人等が走査露光ならびに材料応答性を調べたところでは、一定速度で行われる連続的な一定出力ビーム走

査の場合、材料の光硬化深度が一定となり、リブルもないということがわかった。しかしながら、普通のベクトル・スキャナを用いた場合、走査速度は特殊な設備を用いなくば全体的にかなり変化することになる。スキャナ・ミラーが最高角速度まで加速し、次いで、最高角速度から各ベクトルの終わりのスポットまで加速するときに各ベクトルの初めて速度変化が生じる。スポット速度は走査半径（像平面からの走査ミラーの距離）と共に線形に変化し、第1図の光硬化性組成物の表面46を横切って非線形に変化する。これは、像平面が立体像形成の際に通常平らであり、ベクトル・スキャナが通常は像平面の上方の距離のところにあるポイントに置かれるからである。これらの影響を避けるべく、スキャナは、通常、入射面46から適切に遠く離れたところに設置され、非線形速度変化をすべての実用上の目的にとって無視し得るもの

ユーザ制御手段34によって制御される切り換え速度で優れた変調効率を与えるサイズのものとなる。切り換え速度は、薄層の製造のためには普通は、2～20メガヘルツのオーダーである。音響光学変調器を通過した後、露光をまったく行うつもりのないゼロ次ビーム（あるいは、露光を行おうとしているときにゼロ次、1次および普通は他の次数のビーム）は別のくさびを通り、このくさびがビームを残りの光路の下方水平方向に再整合させる。このくさびの後、ビームは負レンズで拡散させられる。次いで、第1次ビームを除いて、拡散させられたゼロ次ならびに他の次数のビームは光路下方での別の伝送を阻止される。もし存在するとして、第1次ビームは光路下方で継続させられ、そこにおいて、長焦点距離レンズを通り、X-Y走査ミラー20、22を通して方向付けられる。これらのミラーはこのビームをビーム12として光硬化性組成物

としている。光学機器も、露光ビームの焦点深度が十分に長くてビーム12を入射面46におけるすべてのポイントでほぼ平行とし得るように選ぶ。

好ましいシステムでの光学機器は、すべて、好ましくは紫外線領域で作動するレーザ・ビームを最適条件で透過させ得るようにコート処理される。まず、レーザ・ビーム12は安全インターロックが開かれたときにビームを遮る手段として用いられる機械的シャッターを通る。次に、音響光学式変調器の静的、動的動作にとって最適となる或る直径まで合焦、平行となる。ビーム視準光学機器に続いて、光は、ビーム方向を水平に変えてブラッグ角で音響光学変調器クリスタルに入射させるくさびを通して伝送される。音響光学変調器を通過しているときのビーム直径は完全に均一であり、静的なオン状態で第1次までの最大回折効率を許すと同時に第2コンビ

40の表面46に反射する。ミラーから表面46までの距離は最終レンズの焦点距離よりやや短い。最終レンズの焦点距離は長く、したがって、走査半径も長くなり、この光学形が像表面全体において完全に均一な焦点直径を持つことを保証し、また、ビームが走査角による低い非点収差を持つことになるのを保証する。所与の切り換え周波数にとって音響光学変調器を通過する最適なビーム直径についての計算はこの分野では周知であり、ここでは簡略化のために詳しく説明しない。

これらの条件が満たされたとき、連続ビーム走査のスポット速度の変化は、直接、走査方向（X方向）ならびに走査方向に対して直角の方向（Y方向）における光硬化厚さ、光硬化深度の変化に言い換えられる。スポットは、先に説明したように、表面46とビーム12の交点である。走査ビームが連続的である場合、式〔3〕は

表面46上の任意の位置 $l(X, Y, z)$ での光硬化厚さを計算するのに用いることができるが、ただし、この位置でのスポット速度が既知であり、この速度が Y 方向に沿って変化しない(すなわち、走査速度が像平面において無限の曲率半径を持つ)としなければならない。

ベクトル走査の場合、一層詳しくは、本発明を説明するのに用いられる装置の場合、偏向手段の最大許容加速度(一回のミラー回転におけるもの)が特定の値にセフトされ、それ相当に適切な走査半径が使用される。或る代表的なシステム仕様は次の通りである。

偏向手段で発生したボクセルは X, Y, Z 寸法が等しく、各ボクセルの所望寸法はそれぞれの寸法で $0.0127\text{cm}(0.005")$ である。

ビーム放射照度の関数 $G(\Sigma E(\text{mJ}/\text{cm}^2))$ として或る露光を受けた材料を用いて達成される光硬化深度 (cm) は次の関数演算子によって表現

される。

$$G(\Sigma E)(\text{cm}) = -0.066 + 0.0446 \ln(\Sigma E) - 0.00356(\ln(\Sigma E))^2 \quad (4)$$

像平面において単一の走査線で走査される $0.0127\text{cm} \ 1/e^{-0.693}$ 直径スポット(すなわち $r_0 = 0.0108\text{cm} \ 1/e^{-2}$)において 300mW のレーザー出力で $D = 0.0127\text{cm}$ 深さのボクセルを生じさせる $G(\Sigma E)$ 感度の材料の場合、最高走査速度($V_{x\text{max}}$)は式(1)と式(4)を組合わせ、その結果生じた二次方程式を解答することによって決まる。

$$V_{x\text{max}} = \frac{\text{Exp}((1/2C)((B+2C \ln(P/\sqrt{2\pi} r_0)) - \{(B+2C \ln(P/\sqrt{2\pi} r_0))^2 - 4C(A-D+B \ln(P/\sqrt{2\pi} r_0) + C(\ln(P/\sqrt{2\pi} r_0)^2)\})}{2C}}}{(5)}$$

ここで、 A, B, C は材料応答性等式 $G(\Sigma E)$ の材料係数を表わす(すなわち、 $A = -0.066, \dots, B = 0.0446, \dots, C = -0.00356, \dots$)。

こうして、スキヤナが最高速度に達するのに採用する時間、距離について容易に解決できる。

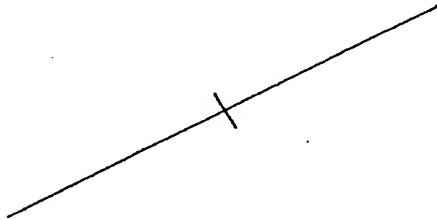
この場合、約7.02ミリ秒を採るが、適正な露光が達成されるまで 4.65cm を移動しなければならない。この時間と移動距離のとき、材料は大きく露出過剰となり、光硬化深度が所望程度よりもかなり深くなる。換言すれば、走査システムは付加的な設備がまったくなくとき所望公差の或る部分(この場合、1本の線)を生じさせるのに適した露光エネルギーの解像度を与えない。

第10図および第11図はこの加速期間中の過露出と光硬化深度公差の損失を示す。ここで先に説明したようにベクトル走査システムの場合、 300mW の強度を有する、第1図のビーム12"のようなビームは大きく改善された走査速度を潜在的に与え、走査中に連続的にオンに留まり、約 4.65cm の移動距離まで光硬化性材料における所望の露光レベル、したがって、光硬化深度を発生することがない。この過剰な露光が走査の終りで生じ、また、スキヤナが1つのスポットま

で減速するので、 300mW ビームを持つスキヤナシステムは像平面(第1図の表面46)のあらゆる部分で所望厚さの層を走査することができない。第11図は、第10図に示す曲線の開始部分の拡大図であり、走査中に連続的にオンである 15mW ビームでも各走査線の始まりで過剰露光を生じさせることを示している。同様の過剰露光は各ベクトルの終りでも生じよう。影響を受けるのは、所望露光点での光硬化深度だけでなく、走査線を囲む領域における光硬化の厚さも影響を受ける。

個々のベクトルの始まりと終りでのこの公差の喪失は部分横断面を表わす層を盛るように互いに隣り合った一連のベクトルでも明らかである。この層はベクトル盛り分の始まりと終りに対応する線のところで余分な光硬化深度を得ることになる。線のところでこの余分な光硬化深度が生じるという事実は、外面のところでの公

差コンプライアンスについて通常は部分的な測定が行われるので、部分全体または剛性物体の公差喪失に通じる。したがって、この部分は各横断面で望まれるよりも幅が大きくなり、孔が所望程度よりも直径が小さくなり（ベクトル走査では孔がベクトルの別の始まり、終りを表わす）、片持ち部分、架構部分あるいは傾斜部分において望まれるよりも深くなる。上述した15mWビームの場合には、それで作られる剛性物体は公差セット限度に依存してかろうじて許容できる程度であるが、300mWで作った部分または剛性物体が過剰に大きくゆがめられることになることは確かである。



ルスを有し、ストップから最高速度まで加速するこのような変調ベクトル走査システムのための一般化した露光方程式は次の通りである。

$$\frac{1}{(\pi r_o^2)} \sum_{Y=0}^{Y_k} \sum_{X=0}^{X_p} \exp[-2(Y-Y_k)/(r_o)^2] \int_0^{t+w} P \exp[-2((0.5 a t^2 - X_p)/(r_o)^2) * 2] dt \quad (6)$$

ここで、 t はベクトルの始まるの時刻を表わし、 Y_k は走査線 Y_o から出発して走査方向に対して直角の距離のところで各走査の中心線を表わし、 X_p は X_o のところで出発して走査線に沿って各パルスが位置する距離を表わし、「 a 」は走査方向におけるスポットの加速を表わす。

式(4)を積分すると、 X の点から幾分処理が容易になり、次の形に書き直すことができる。

$$X_{ptw}(2X_p a)^{-0.5+0.5a w^2} \int_{X_p}^{X_p} (P/(2X a)^{0.5}) \exp[-2((X-X_p)/(r_o)^2) 2] dx \quad (7)$$

代表的には、式(6)の積分の代わりに式(7)の積分を用いて像平面内の或るポイントでの露光を計算する場合、このポイントからの $1/e^2$

一方、露光制御を利用すれば、より高い出力のレーザを使用でき、したがって、より速い走査速度を利用でき、露光解像度がかなり改善され、かなり緊密な部分公差に合わせた能力を得ることができる。基本的には、本発明の好ましい実施例では、露光制御はスポットが光硬化性組成物の表面上を移動する単位距離あたりの或る設定時間にわたってレーザ・ビームを確実にオンにすることによって走査ベクトルにわたって均等な露光を与える。先に説明したように、レーザ・ビームは各ボクセルに対して多数回の露光に分けるように変調される。各露光中のビームの出力すなわち強さは同じであり、露光パルスの時間も同じである（ただし、後述するように各ベクトルの始まりと終りを除く）。これはベクトル走査線に沿って実質的にもっと均一な露光を与える。

等しい時間幅(w)のデジタル方形波時間バ

(3~4シグマ)半径の半分から2倍に存在するパルスの露光分担量を合計しなければならない。このポイントについてひとたび全露光量が計算されたならば、式(4)に記載されている演算子関数を用いてそのポイントでの露光値を予測することができる。

デジタル・コンピュータ近似法を用いて、各寸法でのボクセル・サイズが 0.0127cm であるビーム・スポットの $1/e^{0.693}$ 直径の間隔で他のベクトル走査で囲まれたベクトル走査について光硬化厚さを計算した。このスポットのパルスはボクセルあたり、スポットから加速されたビームの4倍で生じる。走査半径は大きくして、 $1.27 * 10^{-6}\text{cm/sec}^2$ のスポット加速度を与えた。スポットはパルスあたり $w = 3.93 * 10^{-6}\text{sec}$ にわたってデジタル式にパルス化し、像平面でのビーム出力は 150mW であった。

第12図はこのような走査について予測される

光硬化深度を示す。この曲線は走査線の中心に沿った予測深度を示しており、これが定義によれば光硬化深度となる。ここで、走査線に沿った光硬化深度が1ボクセルについて移動した後の、すなわち、走査間隔に等しい距離にわたる所望一定値を達成することに注目されたい。各ベクトル始まりと終り、すなわち、各充填平面の始まりと終りで1ボクセル長分の損失は、露光制御を行った場合、連続ビーム走査を利用したときに得られるもの以上の重要な改良を要す。より高い出力の露光ビームを利用した場合、露光制御ではもっと速い走査速度を可能とする。しかしながら、始まりと終りで1ボクセル分の損失は或る部分についての所望の寸法におけるセット公差に関してそれ以上の損失になお移行する。

第1ボクセルの損失についての理由を明確に理解するためには、プリセット公差に合わせる

ンコード内のパルス損失によるパルス露光損失のパーセンテージを減らすことはできる。これには、パルス回転率限界によるスキヤナの速度を最終的に制限することのできるエンコード上のパルス密度の増大が必要となる。これには、また、パルス時間幅が比例して減り、ビーム・スイッチの光学的効率を最終的に低下させ、ビームの全出力を低下させかつ最高ビーム速度すなわち走査速度を短縮することが必要となる。

走査半径(第1図のビーム12'の長さ)の短縮はパルス密度を増大させるが、大きなフィールドの走査を許さず、パルス時間幅が比例的に減少して露光量を減らすときのシステムの光学効率の損失のために最終的に自滅することになる。

好ましい解決策は、走査線の始まりの最初のボクセルと終りの最後のボクセル内の最初の2、3のパルスに長いパルス時間を与えることであ

ように露光制御を利用するベクトル走査システムの能力をさらに改善しなければならない。式(6)ならびに隣り合ったスポットの露光量を合計して或るポイントでの全露光量を計算しなければならないという事実を考えると、ベクトルの始まりでは、隣り合った露光が走査の背後に存在せず、走査の前方にのみ存在するということが実現され得る。これは、或る走査の最初のボクセルが後に続くボクセルによって受け取られる露光量の約半分の量を受け取ることを意味する。これは、さらに、パルスを発生するための情報を与える、ミラーに取付けられたエンコードが信号の発生の前に約1パルス分移動しなければならないという事実と組み合わせられる。こうして、普通は、第12図に示す場合の第1ボクセルは計算した露光量よりも4分の1少ない露光量を受け取ることになる。

1ボクセルあたりのパルス量を増大させ、エ

る。これが走査システムの速度を低下させることはないし、走査システムの任意他の部分になんら負の影響を与えることもないが、各ベクトルの始まりと終りでボクセルの回復を許すことになる。

作動に際して、第1図に示す放射線手段10(好ましくは高出力レーザである)は前述したような強さを有する放射ビーム12を与える。この放射ビーム12は変調器14を通過し、その強さがゼロ強さレベルからエネルギーの損失により未変調ビーム強さのそれよりも低い値を有する最大ビーム強さまで変調を受ける。デジタル、アナログ両方のタイプの種々の変調器が使用し得る。デジタルタイプは、システムの電子的な安定性、融通性を高めるので好ましいものであり、音響光学式変調器が好ましい。高エネルギー固体レーザの場合、上述したように、特殊な変調器配置をなさなければならない。次いで、

損失により幾分減少した強さを有する変調された放射ビーム12'は2ミラー20、22組立体の形をしたベクトル・スキャナのような偏向手段16を通過する。各ミラーはそれぞれ異なったモータ24、26によって個別に駆動される。モータ24によって駆動されるミラー20はX方向にビームを偏向し、ミラー22はY方向にビームを偏向する。ここで、X方向はY方向に対して直角である。放射ビーム12'は、付加的な損失により幾分強さは低い、光硬化性組成物40の表面に最も近い薄層48に向けられる。この光硬化性組成物は容器44に入っており、ここで、薄層48の所定の部分の光硬化が生じる。ビームの複合運動はベクトルタイプの運動であり、ビームはベクトル・モードで運動すなわち走査されると言える。電気機械式偏向手段16の慣性により、薄層48上でのビーム12'の速度は偏向手段16の慣性ならびに電気機械的特性によっても制限を受け

のビームの速度ならびに平均残留時間に相互関係があり、第2コンピュータ制御手段34によって処理されてから、ライン50を通して制御指令として変調手段14に送られてビーム12の強さを変調し、その結果、ビーム12の強さと薄層48の所定部位のうち各部位での平均残留時間の積がほぼ一定に留まる。こうして、これら2つのパラメータの積として定義される露光レベルがほぼ一定に留まる。この露光レベルを各隣り合った薄層の所定部分にわたって一定に維持することによって、光光度深度もほぼ一定に保たれる。この補正は、膨らんだ縁が上述したようなベクトル走査における縁のところの低い初期速度による過剰露光の結果として現われる薄層の不支持部分で特に非常に重要である。ビーム12'の強さが高ければ高いほど、あるいは、光硬化性組成物の光感度が高ければ高いほど、露光レベルを一定に保つ手段がない場合にはこの問題は

る。

2つのミラー20、22のモータ24、26を介しての偏向は第2コンピュータ制御手段34によって制御され、一方、製造中の立体物体の形状に対応する図形データは第1コンピュータ制御手段30内に記憶される。

第2コンピュータ制御手段34は変調手段14、偏向手段、第1コンピュータ制御手段30にそれぞれ制御/フィードバック・ライン50、54、58を介して接続している。第1コンピュータ制御手段30に記憶された図形データは第2コンピュータ制御手段34に送られ、処理された後、モータ24、26を回転させ、ミラー20、22を移動させ、放射ビームを薄層48上の所定位置に向って偏向する。ミラー20、22の相対運動に関する電気的フィードバックは偏向手段によってライン54を介して第2コンピュータ制御手段34に与えられる。このフィードバックは薄層48の所定部分で

それだけ厳しいものとなる。また、組成物40の感度が大きければ大きいほど、或る種の露光制御手段なしには問題はそれだけ厳しいものとなる。

可動テーブル41は、当初、光硬化性組成物40内の表面46から短い所定距離のところに設置され、表面46とテーブル41の間に薄層48を与える。テーブルの位置決めは設定手段42によって行われ、この設定手段は第1コンピュータ制御手段30によってそこに記憶されたデータに従って制御される。剛性物体の形状の第1層に対応する図形データは第1コンピュータ制御手段30から第2コンピュータ制御手段34へ送られ、そこにおいて、偏向手段16から得られたフィードバック・データと一緒に処理され、変調器14に送られてそれを制御し、その結果、ビームが薄層48の所定部分上をベクトル・モードで移動するときに、露光量が一定に留まる。

剛性物体の第1層が完了したならば、可動テーブル41を第1コンピュータ制御手段30からの指令を介して設定手段42によって所定の短い距離だけ下降させる。第1コンピュータ制御手段30からの同様の指令により、層形成手段、たとえば、ドクタナイフ43が表面46を試って平らにする。次いで同じ手順が繰り返され、第2の、第3、そしてそれに続く層を製造し、最終的に剛性物体が完成する。

先に述べたように、変調器は放射ビームの強さをほぼゼロの強さから最大強さまでアナログあるいはデジタル・モードで変調する。変調器では或る程度の光学的損失があり、また、偏向手段でも或る程度の付加的な損失がある。最大強さは未変調ビームの強さマイナス全光学的損失に等しい。本発明の好ましい具体例では、最大ビーム強度は光硬化性組成物の感度その他のパラメータに依存して或る値を超える。

を表わし、 Y_k は像平面における位置 $Y=0$ に対する走査線の任意の中心位置(cm)を表わし、 r_0 はビームと光硬化性材料の像平面との交差点におけるビームの $1/e^2$ 半径(cm)であり、 v は像平面における表面上のビーム・スポットの速度(cm/sec)である。

ベクトル走査のベクトルは複数の走査線からなり得る。これらの走査線は1グループあるいはそれ以上のグループの走査線を含み得るし、その場合、各グループの走査線は互いに平行である。或るグループ内の2つの隣り合った走査線の距離は、一定であるときには走査線間の走査間隔となる。しかしながら、或る状況では、走査間隔が線毎に大きく変る可能性はある。この場合、ビームが任意最初の線を走査しているとき、前記最初の線に関係する走査間隔は第1線と第2線との距離に等しい。この第2線とは、他の隣り合った線のうちでも、第1線に最も近

したがって、放射ビームの最大強度が次の式よりも大きい光硬化深度を与えることが好ましい。

光硬化厚さ = $G(\Sigma E) -$

$$G\left(\sum_{Y_k=0}^{Y_k} P \exp(-2((Y-Y_k/r_0)^2))/(\sqrt{2\pi} v r_0)\right)$$

ここで、 $G(\Sigma E)$ は露光 E の合計で演算する関数 $G\{\}$ を表し、この関数演算子は或る特定のポイントあるいは領域で受け取られる露光量の合計(mJ/cm^2)に対して或る特定の材料光硬化深度応答性(cm)を関係付ける。普通は、この関数演算子は次の形の自然対数二次多項式適合である。

$$G(\Sigma E) = \text{光硬化深度} = A + B \ln(E) + C (\ln(E))^2$$

ここで、 A 、 B 、 C はこの関係について良好な数学的適合性を与える或る特定の材料についての係数であり、 Y は像平面における走査方向に対して直角の方向における任意の該当位置(cm)

く、第1線を走査した後には走査される線を言う。

最大加速度で走査線上を放射ビームが移動してゼロ速度レベルから最大一定速度に到達するまでの距離は走査間隔より大きいことが好ましく、もっとも好ましくは、走査間隔の5倍、さらに好ましくは走査間隔の10倍である。

変調器14は、好ましくは、第2コンピュータ制御手段34を介して制御されてほぼ方形波パルスの形で放射ビームをオン、オフする。各パルスは、通常は、ほぼ同じ振幅あるいは強さならびに同じ持続時間を有する。ビームが光硬化性組成物40の表面46を走査するにつれて、パルス周波数は表面46上をビームが移動する速度に比例するように第2コンピュータ制御手段34、走査システム16、フィードバック手段54によって設定される。

光硬化厚さ $=G(\Sigma E) =$

$$G(1/(\pi r_0^2) \sum_{Y_k=0}^{Y_k} \sum_{X_p=0}^{X_p} \text{Exp}(-2((Y-Y_k)/r_0)^2) * \\ * \int_0^{t+w} P \text{Exp}(-2((0.5 a t^2 - X_p)/r_0)^2) dt)$$

ここで、 $G(\Sigma E)$ は露光量 E の合計について演算する関数 $G(\)$ を表わしており、この関数演算子は或る特定のポイントまたは領域で受け取られる露光量の合計 (mJ/cm^2) に或る特定の材料光硬化深度応答性 (cm) を関係付けるものである。通常は、この関数演算子は次の自然対数二次多項式適合である。

$$G(\Sigma E) = \text{光硬化深度} = A + B \ln(E) + C(\ln(E))^2$$

ここで、 A 、 B 、 C はこの関係について良好な数学的適合性を与える或る特定の材料についての係数であり、 r_0 はビームと光硬化性材料の像平面との交差点におけるビームの $1/e^2$ 半径 (cm)であり、 P は時間積分によって示されるようには変調されない場合に他のパラメータによ

い周縁領域では、露光量が少ないため、 Z 方向での光硬化深度は浅くなり、 X 、 Y 方向での光硬化深度も浅くなる。立体像形成過程では、前述のように、物体が層状に形成される場合、光硬化深度が浅いということは直ちに X 、 Y 、 Z 方向における寸法公差の損失を招く。加えて、 Z 方向における光硬化深度の損失は物体の層間の剥離現象の可能性を高める。

この層剥離現象は Z 方向における光硬化性材料の成形が先の層との接合を行うには不適当なために生じる。立体像形成過程では、層間の接合は第1図に48で示す先行して光硬化した領域上方の液体層の深さに等しい深さの光硬化層を形成するに必要とするよりもやや高い露光を行うことによってなされる。この層剥離は物体の周縁で生じ、薄い壁部分を作る積層体に重要な影響を与える。

層剥離を防ぐように制御されなければならない

って示される状況の下で望まれるよりも大きい重合深度を与える、像平面におけるビームの最大放射照度 (mW)であり、 X 、 Y は像平面における光硬化性液体の表面の位置 (cm 、 cm)を表わし、 Y_k は像平面における位置 $Y=0$ に対する走査線の任意の中心位置 (cm)を表わし、 X_p はビーム・パルスを受ける像平面における位置 $X=0$ に対する走査線に沿った任意の初期位置 (cm)を表わし、 t は像平面において或るパルスが照射を開始する時刻 (sec)を表わし、 w は像平面において照射パルスが持続する時間 (sec)を表わし、「 a 」は反射ミラー式スキャナの各加速度能力と走査半径とによって決められる、像平面におけるスポットの加速度 (cm/sec^2)を表わす。

露光制御手段を通しての被走査層の周縁領域における光硬化公差の制御は特に重要である。ベクトルの始まりと終りからなり、ベクトルの分担露光量が隣接の平行なベクトルよりも少な

い変数としては、像平面におけるビーム出力 P (mW)、露光時刻 t (sec)、スポット・サイズ r_0 (cm)、走査間隔 $Y(k+1) - Y_k(\text{cm})$ 、パルス間の距離 $X(p+1) - X_p(\text{cm})$ および再走査技術がある。

層剥離ならびに公差損失を防ぐには、ビーム出力をアナログ手段 (たとえば、前述の音響光学式変調器) を介して高めて隣接の露光による影響が少ない領域における正味露光量の損失を補正するとよい。あるいは、前記のデジタルパルス化音響光学変調器のようなデジタル制御手段によって個々のビーム出力パルスの時間幅を増大させることによって露光時間を延ばして隣接の露光による影響が少ない領域における正味露光量の損失を補正してもよい。再走査技術というのは、光硬化層を平行な走査線で形成する前か後にこの層の任意の周縁部分を走査する技術であり、物体あるいは層の任意の周縁部分で受け取られる低い露光量を補正することに

なる。

スポット・サイズを大きくし、走査間隔を縮めるかあるいはパルス間隔を縮めると、露光量が一層均一となり、より確かな接着領域が達成されるので層間の接着性を改善するが、層剥離を防ぐために同様領域でこのような方法を使用すると、物体公差について悪影響があるかも知れない。

本発明の好ましい具体例では、隣接の露光による影響が少ない領域での公差の損失ならびに層接着性の低下は、これが先に述べたようにベクトルの始まりと終りでの影響によるものであろうと、隣接のベクトル走査による影響のない走査線によるものであろうと、デジタル・パルス化音響光学式変調器の露光時間幅パルス制御によって補正される。

放射ビーム12の好ましい変調方法はデジタル式であるが、アナログ・モードあるいはアナ

ログ、デジタル・モードの組合わせでの変調も本発明の範囲内にある。

ビーム12は紫外線であると好ましいが、赤外線でも、可視光線でも、赤外線あるいは可視光線と紫外線の組合わせでもよいし、他の放射線、たとえば、X線、電子ビーム、イオン・ビーム等であってもよい。

最後に、テーブル41の運動は並進運動、回転運動、無作為運動あるいはそれらの組合わせであってもよい。

立体像形成のための光硬化性組成物は少なくとも1種の光硬化性モノマーまたはオリゴマーおよび少なくとも1種の光開始剤を含有すべきである。本発明の目的にとってモノマーおよびオリゴマーと言う用語は実質的に同等でありそれらは交換可能に使用され得る。

単独でまたは他のモノマーと組み合わせて使用できる適当なモノマーとしてはヒープチルア

クリレート、ヒープチルメタクリレート、1,5-ペンタンジオールジアクリレートおよびジメタクリレート、N,N-ジエチルアミノエチルアクリレートおよびメタクリレート、エチレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、1,4-ブタンジオールジアクリレートおよびジメタクリレート、ジエチレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、ヘキサメチレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、1,3-プロパンジオールジアクリレートおよびジメタクリレート、デカメチレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、1,4-シクロヘキサジオールジアクリレートおよびジメタクリレート、2,2-ジメチロールプロパンジアクリレートおよびジメタクリレート、グリセロールジアクリレートおよびジメタクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、グ

リセロールトリアクリレートおよびトリメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートおよびトリメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレートおよびトリメタクリレート、ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリアクリレートおよびトリメタクリレートおよび米国特許第3,380,831号に開示されたような同様の化合物、2,2-ジ(ヒドロキシフェニル)-プロパンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレートおよびテトラメタクリレート、2,2-ジ(p-ヒドロキシフェニル)-プロパンジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ポリオキシエチル-2,2-ジ(p-ヒドロキシフェニル)プロパンジメタクリレート、ビスフェノール-Aのジ-(3-メタクリルオキシ-2-ヒドロキシプロピル)エーテル、ビスフェノール-Aのジ-(2-メタクリルオキシエチル)エーテル、

ビスフェノール-Aのジ-(3-アクリルオキシ-2-ヒドロキシプロピル)エーテル、ビスフェノール-Aのジ-(2-アクリルオキシエチル)エーテル、1,4-ブタンジオールのジ-(3-メタクリルオキシ-2-ヒドロキシプロピル)エーテル、トリエチレングリコールジメタクリレート、ポリオキシプロピルトリメチロールプロパントリアクリレート、ブチレングリコールジアクリレートおよびジメタクリレート、1,2,4-ブタントリオールトリアクリレートおよびトリメタクリレート、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジアクリレートおよびジメタクリレート、1-フェニルエチレン-1,2-ジメタクリレート、ジアリルフマレート、スチレン、1,4-ベンゼンジオールジメタクリレート、1,4-ジイソプロペニルベンゼン、および1,3,5-トリイソプロペニルベンゼンが挙げられる。

ルニルアルコール例えばベンゾイン、ビバロイン；アクロインエーテル例えばベンゾインメチルおよびエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール； α -メチルベンゾイン α -アリルベンゾイン、および α -フェニルベンゾインを含む α -炭化水素-置換-芳香族アシロインが含まれる。

開始剤としては米国特許第2,850,445号、同第2,875,047号、同第3,097,096号、同第3,074,974号、同第3,097,097号および同第3,145,104号に開示されている光還元性染料および還元剤、並びにフェナジン、オキサジン、キノン群の染料、Michlerのケトン、ベンゾフェノン、アクリルオキシベンゾフェノン、ロイコ染料を含む水素ドナーを有する2,4,5-トリフェニルイミダゾリルダイマーおよび米国特許第3,427,161号、同第3,479,185号および同第3,549,367号に開示されているようなその混合

また有用なものとしては分子量が少なくとも300であるエチレン系不飽和化合物例えばアルキレンまたは炭素数2~15のアルキレングリコールから製造したポリアルキレングリコールジアクリレートまたは1~10のエーテル結合のポリアルキレンエーテルグリコールおよび米国特許第2,927,022号に開示されたもの、例えば特に端末結合として存在する場合複数の付加重合可能なエチレン系結合を有するものが上げられる。特に好ましいモノマーとしてはポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリアクリレート、エチル化ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート、および1,10デカンジオールジメチルアクリレートが挙げられる。

本発明において単独でまたは組み合わせて使用される有用な光開始剤は米国特許第2,760,863号に示されており、ビシナルケトア

物を使用出来る。

また有用な光開始剤としては米国特許第4,162,162号に開示されているような増感剤である。

熱的に不活性であるが185℃以下で活性光線に露光すると遊離基を生成する適当な他の光開始系としては共役した炭素環系内に二つの環内炭素原子を有する化合物である置換されたまたは置換されていない多核キノン例えば9,10-アントラキノ、2-メチルアントラキノ、2-エチルアントラキノ、2-ヒープチルアントラキノ、オクタメチルアントラキノ、1,4-ナフトキノ、9,10-フェナントラキノ、ベンズアントラセン-7,12-ジオン、2,3-ナフトセン-5,12-ジオン、2-メチル-1,4-ナフトキノ、1,4-ジメチル-アントラキノ、2,3-ジメチルアントラキノ、2-フェニルアントラキノ、2,3-ジフェニルア

ントラキノン、レテネキノン、7,8,9,10-テトラヒドロナフタセン-5,12-ジオン、および1,2,3,4-テトラヒドロベンズアントラセン-7,12-ジオンが挙げられる。前記の光開始剤または光開始剤系は光硬化性組成物の全重量の0.05~10重量%で存在する。

光硬化の好ましいメカニズムはラジカル重合であるが光硬化の他のメカニズムの適用も本発明の範囲内にある。前記の他のメカニズムとしてはカチオン重合、アニオン重合、縮合重合、付加重合、などが挙げられるがこれに制限されるわけではない。

好ましい光硬化組成物を実施例1に示す。

実施例 1

Novacure 3704 〔ビスフェノール-Aビス(2-ヒドロキシプロピル)ジアクリレート〕	29.6
TMPTA(トリメチロールプロパントリアクリレート)	29.6
Plasthall 4141(CP Hall社)(トリエチレングリコールカブレート-カブリレート)	14.8

分間バージして、次いで80℃に加熱した。この温度でブチルアクリレート(BA)1046g、アリルメタクリレート(AMA)279gおよび1,4-ブチレングリコールジアクリレート(BGD)70gからなるモノマー材料の8分の1を一度に加えた。続いて直ちにリン酸水素ナトリウムの7%溶液19mlおよび過硫酸アンモニウムの5%溶液20ml(いずれも水溶液)を一度に加えた。加熱を中止し、反応混合物の発熱にまかせた。発熱により84℃のピクとなった時、残りのモノマー材料を90分かけて反応温度が80~85℃に維持するように断続的に加熱しながら加えた。モノマーの添加(全モノマー材料1345g)が終了したら、さらに反応混合物を2.5時間80~85℃で加熱した。最終生成物は青みを帯び、固形分35.1%を有する乳化液であり粒径0.097ミクロンを有した。

シエル

上述のコア乳化液2000gをコアを調製すると

Triton X-100(オクチルフェノールポリエーテルアルコール)	0.78
Irgacure 651(2,2-ジメトキシ2-フェニルアセトフェノン)	1.6
コア-シエルポリマー*(RCP 1674)	26.0

上記のコア-シエルポリマー*は

ブチルアクリレート	70%
ブチレングリコールジアクリレート	5%
アリルメタクリレート	25%
からなるコアと	
メチルメタクリレート	100%

からなるシエルを有する。

前記のコア-シエルポリマーは以下のように調製した。

コア

脱イオン水2388gおよびドデシルスルホン酸ナトリウムの30%水溶液37.5gを機械式攪拌機、凝縮器、加熱マントル、添加用漏斗、温度計および窒素取入口を備えた5ℓの4フロラスコに入れた。フラスコの内容物を室温下窒素で30

分に使用したのと同じ装置を備えた5ℓのフラスコに入れた。フラスコ内容物を窒素により室温で30分間バージした。窒素バージの後、過硫酸アンモニウム1.45g、ドデシル硫酸ナトリウム30%水溶液2.9gおよび脱イオン水332gからなる混合物を攪拌しながらフラスコに30分かけて加えた。次いでフラスコの内容物を85℃に加熱して、メチルメタクリレート179gを60分間かけて加えた。すべてのモノマーを加えて、更に反応混合物を2時間加熱した。最終生成物は青みを帯び、固形分36.2%を有する乳化液であり粒径0.107ミクロンを有した。コア：シエルの比率は実質的に4：1であった。

青みを帯びた乳化液をフリーザー中に3日間置いて、次いで解凍し濾過し脱イオン水で洗浄し、そして室温で約3日間乾燥した。試験工場またはプラントでのパッチの場合のような大きな試料のために、100~150℃の熱風などのスプ

レードライ法を用いてもよい。

以上本発明を詳細に説明したが本発明はさらに下記の実施態様によりこれを要約して示すことができる。

1) 液状光硬化性組成物の重なった層から一体の三次元剛性物体を製作する方法であって、

容器内に液状光硬化性組成物を設置する段階と、

放射線装置を用いて或る強さの放射ビームを発生させる段階と、

この放射ビームの強さをほぼ零から最大値まで変調手段によって制御しながら変調する段階と、

偏向手段を用いることによって、放射ビームを重ねた薄い層上の所定位置までベクトル走査モードで制御しながら偏向させて液状光硬化性組成物の所定部分の光硬化を或る光硬化深度まで行くと共に、ゼロ・レベルから最

の重なった薄い層を形成する段階と、
からなることを特徴とする方法。

2) 放射ビームの最高強度が

$$G(\Sigma E) = G \left\{ \sum_{Y_k=0}^{Y_k} P \exp(-2((Y-Y_k/r_0)^2)) / (\sqrt{2\pi} v r_0) \right\}$$

によって与えられる値より大きい光硬化深度を生じさせ、ここで、 $G(\Sigma E)$ は光硬化材料の深度を露光 E (mJ/cm^2)応答曲線に数学的に合わせる等式であり、 Y_k (cm)は像平面における $Y=0$ に対して設置された各走査線の中心を表わし、 Y (cm)は走査方向に対して直角に延びる軸線を持つ可変位置であり、 P は像平面における露光ビームの放射照度(mW)であり、 v は像平面でのビーム・スポットの速度(cm/sec)であり、 r_0 は像平面と交差するガウスビーム・スポットの $1/e^2$ 半径(cm)であることを特徴とする、前項1記載の方法。

3) ベクトル走査が互いにはほぼ平行な多重走査

高値までの加速度で、そして、ゼロ・レベルから最高値までの速度で放射ビームを偏向させる段階と、

剛性物体の形状に対応する図形データを記憶する段階と、

第2のコンピュータ制御手段を前記変調手段、偏向手段および第1コンピュータ制御手段と接続し、液状光硬化性組成物の所定部分をほぼ一定の露光レベルで照射して各重なった薄い層内でほぼ一定の光硬化深度を達成する段階と、

容器内でほぼ平らな可動テーブル上に剛性物体を置く段階と、

設定手段を用い、それを第1コンピュータ制御手段で制御することによって平らなテーブルを制御状態で移動させる段階と、

第1コンピュータ制御手段によって制御される層形成手段によって液状光硬化性組成物

線を包含し、これら走査線が或る走査間隔を有し、或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから最高一定速度に達するまでの距離が前記走査間隔よりも大きいことを特徴とする、前項2記載の方法。

4) 或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから前記特定の最高一定速度に達するまでの距離が前記走査間隔の5倍よりも大きいことを特徴とする、前項3記載の方法。

5) 或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから前記特定の最高一定速度に達するまでの距離が前記走査間隔の10倍よりも大きいことを特徴とする、前項4記載の方法。

6) 放射ビームの強さを或る特定の周波数でパルスに変調し、各パルスが或る特定の持続期間、強さを有するようにしたことを特徴とす

る、前項3記載の方法。

- 7) パルスがほぼ等しい持続時間、ほぼ等しい強さ、前記ビーム速度に比例する可変周波数を持つことを特徴とする、前項6記載の方法。

- 8) 加速中の放射ビームの強さが次の式の値にほぼ等しい光硬化厚さを与え、

$$G(\Sigma E) = G \left[\frac{1}{(\pi \cdot ro^2)} \sum_{Yk=0}^{Yk} \sum_{Xp=0}^{Xp} \exp\{-2(Y-Yk)/ro\}^2 \right] * \\ * \int_0^{t+w} P \exp\{-2((0.5 a t^2 - Xp)/ro)^2 dt\}$$

ここで、 $G(\Sigma E)$ は光硬化した材料の深度を露光 E (mJ/cm^2) 応答曲線に数学的に合わせる等式であり、 ro は像平面と交差するガウスビーム・スポットの $1/\sigma^2$ 半径 (cm) であり、 Yk (cm) は像平面における $Y=0$ に対して位置した各走査線の初めを表わし、 Xp (cm) は像平面における $X=0$ に対して位置した各ビーム・パルスの中心を表わし、 X (cm) は走査方向に対し

前項2記載の方法。

- 13) 液状光硬化性組成物の重なった薄い層から一体の三次元剛性物体を精密に製作する装置であって、

液状光硬化性組成物を入れた容器と、

或る強さを有する放射ビームを与える放射手段と、

放射ビームの強さをほぼゼロ・レベルから最高レベルまで変調する変調手段と、

放射ビームをベクトル走査モードで重なった薄い層上の所定位置まで制御しながら偏向させて液状光硬化性組成物の所定部分の光硬化を或る光硬化深度まで行い、また、ゼロ・レベルから最高値までの加速度で、また、ゼロ・レベルから最大の一定速度の速度でビームを制御しながら偏向させる偏向手段と、

剛性物体の形状に一致する図形データを記憶する第1コンピュータ制御手段と、

て平行に延びる軸線を有する可変位置であり、 Y (cm) は走査方向に対して直角に延びる軸線を有する可変位置であり、 t (sec) は個々のビーム・パルスが任意の時刻 $t=0$ に対して像平面で始まる時刻であり、 w (sec) は各パルスの時間幅であり、 P は像平面で各パルスの露光ビームにおける放射照度 (mW) であり、 a は像平面におけるビーム・スポットの加速度 (cm/sec^2) であることを特徴とする、前項7記載の方法。

- 9) 放射ビームの強さをアナログ・モードで変調することを特徴とする、前項2記載の方法。

- 10) ビームが赤外線からなることを特徴とする、前項2記載の方法。

- 11) ビームが可視光線からなることを特徴とする、前項2記載の方法。

- 12) ビームが紫外線からなることを特徴とする、

変調手段、偏向手段および第1コンピュータ制御手段と接続しており、液状光硬化性組成物の所定部分にほぼ一定の露光レベルを与えて各重なった薄い層内でほぼ一定深さの硬化を行う第2コンピュータ制御手段と、

容器内で剛性物体を支持するほぼ平らな可動テーブルと、

第1コンピュータ制御手段によって制御され、可動テーブルに動きを与えて容器内の可動テーブルの位置を精密に制御する設定手段と、

可動テーブル上に設置してあり、第1コンピュータ制御手段によって制御されて液状光硬化性組成物の重なった薄い層を形成する層形成手段と

を包含することを特徴とする装置。

- 14) 放射ビームの最高強度が

$$G(\Sigma E) = G \left(\sum_{Y_k=0}^{Y_k} P \exp[-2((Y-Y_k/ro)^2)] / (\sqrt{2\pi} v ro) \right)$$

によって与えられる値より大きい光硬化深度を生じさせ、ここで、 $G(\Sigma E)$ は光硬化材料の深度を露光 E (mJ/cm^2) 応答曲線に数学的に合わせる等式であり、 $Y_k(cm)$ は像平面における $Y=0$ に対して設置された各走査線の中心を表わし、 $Y(cm)$ は走査方向に対して直角に延びる軸線を持つ可変位置であり、 P は像平面における露光ビームの放射照度(mW)であり、 v は像平面でのビーム・スポットの速度(cm/sec)であり、 ro は像平面と交差するガウスビーム・スポットの $1/e^2$ 半径(cm)であることを特徴とする、前項13記載の装置。

- 15) ベクトル走査が互いにはほぼ平行な多重走査線を包含し、これら走査線が或る走査間隔を有し、或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから最高一定速度に

強さ、前記ビーム速度に比例する可変周波数を持つことを特徴とする、前項18記載の装置。

- 20) 加速中の放射ビームの強さが次の式の値にほぼ等しい光硬化厚さを与え、

$$G(\Sigma E) = G \left(\frac{1}{(\pi ro^2)} \sum_{Y_k=0}^{Y_k} \sum_{X_p=0}^{X_p} \exp[-2((Y-Y_k/ro)^2)] * \int_t^{t+w} P \exp[-2((0.5 a t^2 - X_p)/ro)^2] dt \right)$$

ここで、 $G(\Sigma E)$ は光硬化した材料の深度を露光 E (mJ/cm^2) 応答曲線に数学的に合わせる等式であり、 ro は像平面と交差するガウスビーム・スポットの $1/e^2$ 半径(cm)であり、 $Y_k(cm)$ は像平面における $Y=0$ に対して位置した各走査線の中心を表わし、 $X_p(cm)$ は像平面における $X=0$ に対して位置した各ビーム・パルスの初めを表わし、 $X(cm)$ は走査方向に対して平行に延びる軸線を有する可変位置であり、 $Y(cm)$ は走査方向に対して直角に延びる

走査するまでの距離が前記走査間隔よりも大きいことを特徴とする、前項13または前項14記載の装置。

- 16) 或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから前記特定の最高一定速度に達するまでの距離が前記走査間隔の5倍よりも大きいことを特徴とする、前項15記載の装置。
- 17) 或る走査線上をビームが最高加速度で移動してゼロ速度レベルから前記特定の最高一定速度に達するまでの距離が前記走査間隔の10倍よりも大きいことを特徴とする、前項16記載の装置。
- 18) 放射ビームの強さを或る特定の周波数でパルスに変調し、各パルスが或る特定の持続期間、強さを有するようにしたことを特徴とする、前項15記載の装置。
- 19) パルスがほぼ等しい持続時間、ほぼ等しい

軸線を有する可変位置であり、 $t(sec)$ は個々のビーム・パルスが任意の時刻 $t=0$ に対して像平面で始まる時刻であり、 $w(sec)$ は各パルスの時間幅であり、 P は像平面で各パルスの露光ビームにおける放射照度(mW)であり、 a は像平面におけるビーム・スポットの加速度(cm/sec^2)であることを特徴とする、前項19記載の装置。

- 21) 放射ビームの強さをアナログ・モードで変調することを特徴とする、前項14記載の装置。
- 22) ビームが赤外線からなることを特徴とする、前項14記載の装置。
- 23) ビームが可視光線からなることを特徴とする、前項14記載の装置。
- 24) ビームが紫外線からなることを特徴とする、前項14記載の装置。
- 25) 走査線が初めと終りを有し、走査線の初め

と終りで $1/e^2$ スポット半径の2倍に等しい距離内のビーム・パルスの持続時間がパルスの残部のそれよりも大きいことを特徴とする、前項20記載の装置。

26) 或る層の任意の周縁部分からの $1/e^2$ スポット半径の2倍に等しい距離内の走査線がパルスの残部の持続時間よりも大きい持続時間のビーム・パルスを有することを特徴とする、前項20記載の装置。

27) 或る層の任意の周縁部分が層の平行走査線に加えて走査されることを特徴とする、前項20記載の装置。

28) ビーム放射が像平面に形成された或る層の任意の周縁部分の $1/e^2$ スポット半径の2倍以内で或る層の残部のそれより大きい露光を与えるように変調手段によってアナログ方式で制御されることを特徴とする、前項15記載の装置。

走査間隔の影響を示す図である。

第9図は走査線速度対走査間隔の関係を示す図である。

第10図および第11図は露光レベルを一定に保つ設備が設けられていないときにストップから最大加速度の下で最小一定光硬化深度に到達するまでに必要なベクトル走査距離についてビーム強さが影響する大きな差を示す図である。

第12図は露光レベルをほぼ一定に保つ設備が設けられているときの光硬化深度対走査方向に沿った距離の関係を示す図である。

10…放射手段、11…立体物体、12…放射ビーム、12'…変調済みの放射ビーム、14…変調器、16…偏向手段、20,22…ミラー、24,26…モータ、30…第1コンピュータ制御手段、34…第2コンピュータ制御手段、40…光硬化性組成物、41…可動テーブル、42…設定手段、43…ドクタナイフ、44…容器、46…像形成面、52,60,62,58…

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の装置の好ましい具体例のブロック図である。

第2図および第3図はピクセル、ボクセルそれぞれの表面ならびに体積の分割を説明する図である。

第4図は実施例1の光硬化性組成物の光硬化層の深さと露光対ビーム放射の関数との関係を示す図である。

第5図は露光分布対走査線を横切る方向の計算深さ、実深さの正規化曲線を比較した図である。

第6図は3つの隣り合った走査線を横切る方向の光硬化深度を示すことを目的とする2つの計算曲線を比較した図である。

第7図は走査線を横切る方向における実際の厚さと計算厚さとを比較する図である。

第8図は横断面方向の光硬化厚さについての

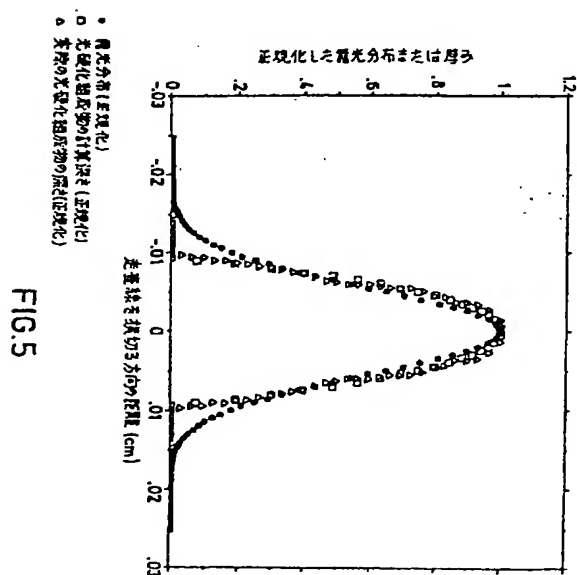
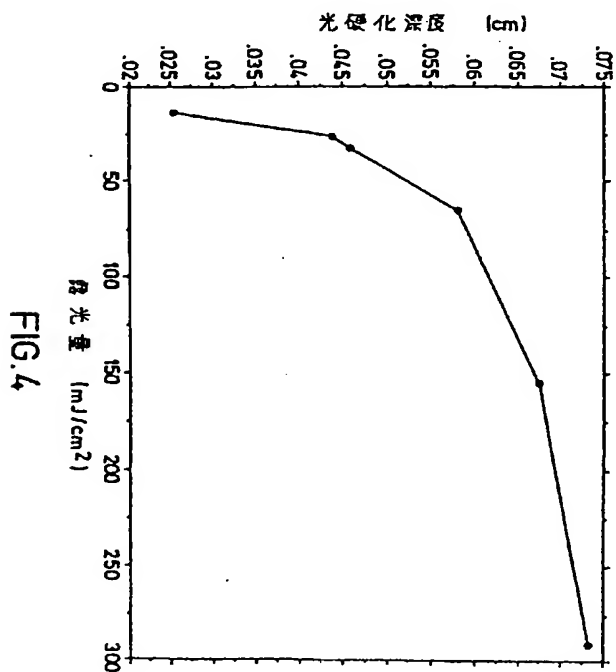
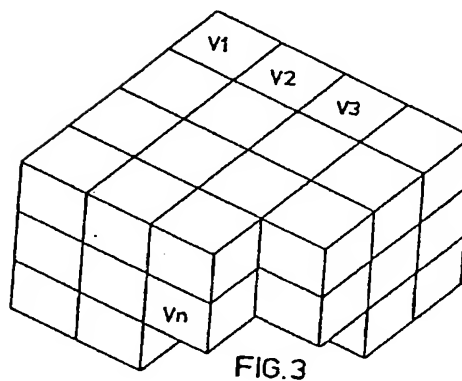
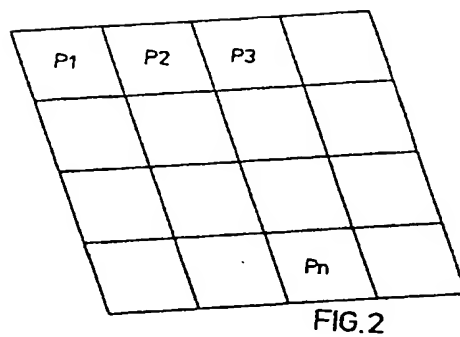
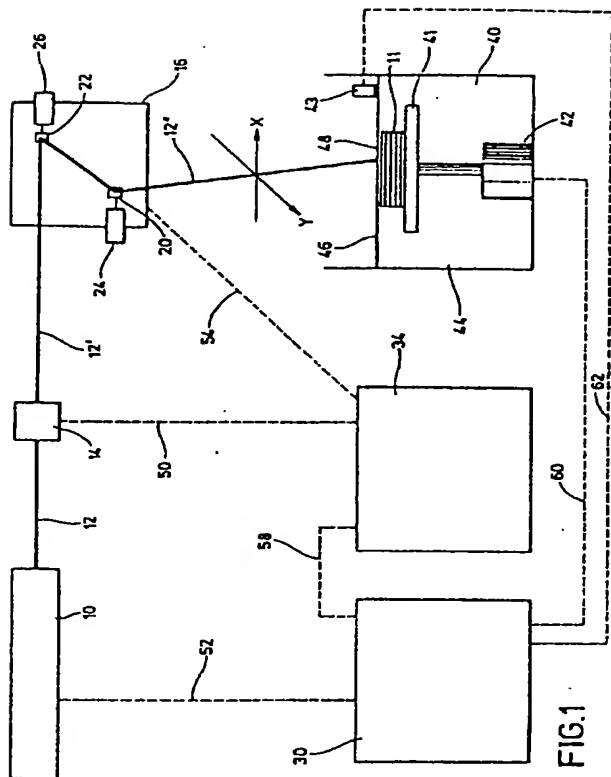
制御/フィードバック・ライン。

特許出願人 イー・アイ・デュボン・ド・ネモ
アース・アンド・カンパニー

代理人 弁理士 高 木 千



外 2 名



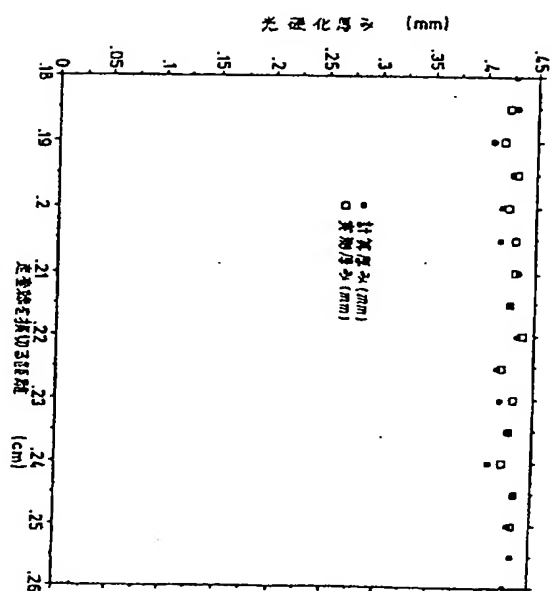


FIG. 7

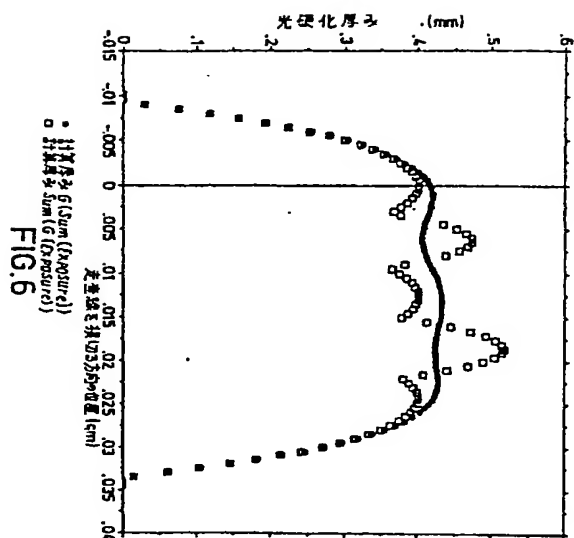


FIG. 6

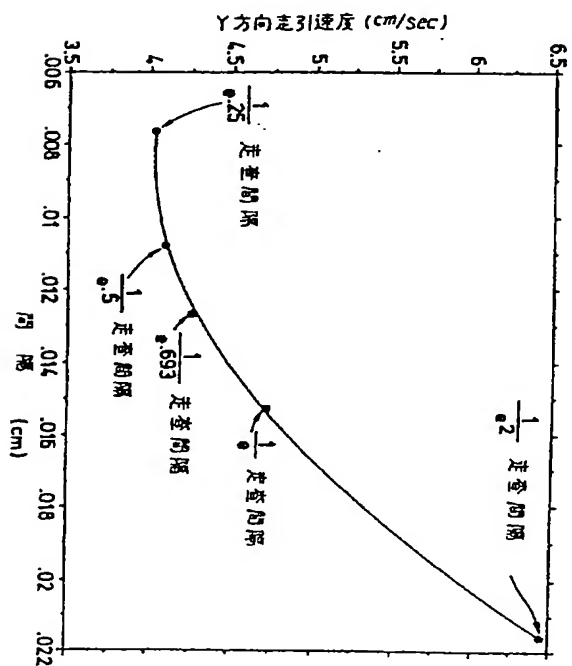


FIG. 9

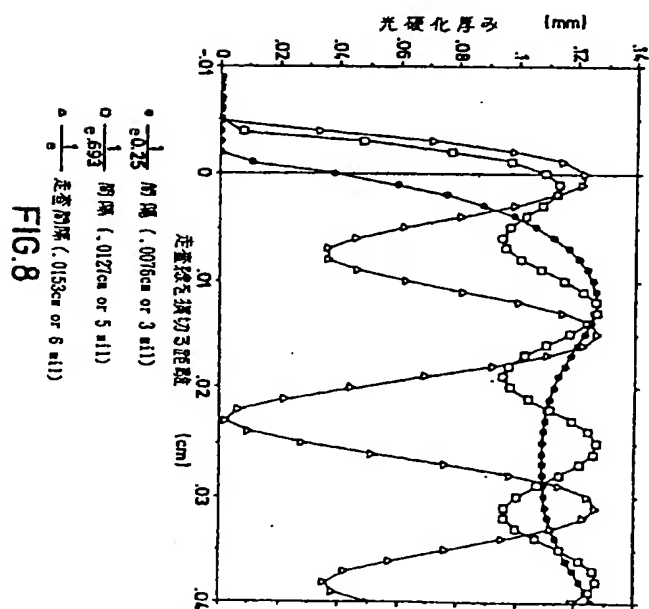


FIG. 8

